



KINTEK SOLUTION

Pacvd Catalogo

Contattaci per ulteriori cataloghi di Preparazione del campione, Apparecchiature termiche, Materiali e materiali di laboratorio, Apparecchiature bio-chimiche, ecc.

KINTEK SOLUTION

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Kintek Solution Ltd è un'organizzazione orientata alla tecnologia, i cui membri si dedicano alla ricerca della tecnologia e delle innovazioni più efficaci e affidabili nel campo delle apparecchiature per la ricerca scientifica, in settori quali la reazione biochimica, la ricerca di nuovi materiali, il trattamento termico, la creazione di vuoto, la refrigerazione e le apparecchiature farmaceutiche e di estrazione del petrolio.

Negli ultimi 20 anni, abbiamo accumulato una ricca esperienza in questo campo delle attrezzature di ricerca, siamo in grado di fornire sia l'attrezzatura che la soluzione in base alle esigenze e alle realtà del cliente, abbiamo anche sviluppato molte attrezzature su misura per il cliente in base a uno scopo di lavoro specifico e abbiamo molti progetti di successo in molte università e istituti di diversi paesi, come Asia, Europa, Nord e Sud America, Australia e Nuova Zelanda, Medio Oriente e Africa.

La professione, la risposta rapida, il lavoro duro e la sincerità è un'etichetta notevole dell'atteggiamento di lavoro dei nostri membri del team, che ci guadagnano una solida reputazione tra i nostri clienti.

Siamo qui e pronti a servire i nostri clienti di diversi paesi e regioni e a condividere insieme la tecnologia più efficace e affidabile!



Forno Tubolare Slide Pecvd Con Gassificatore Liquido Macchina Pecvd

Numero articolo: KT-PE12



introduzione

Sistema PECVD a scorrimento KT-PE12: Ampio range di potenza, controllo programmabile della temperatura, riscaldamento/raffreddamento rapido con sistema a scorrimento, controllo del flusso di massa MFC e pompa del vuoto.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di forno	KT-PE12-60
Temperatura massima	1200°C
Temperatura di lavoro costante	1100°C
Materiale del tubo del forno	Quarzo di elevata purezza
Diametro del tubo del forno	60 mm
Lunghezza della zona di riscaldamento	1x450mm
Materiale della camera	Fibra di allumina giapponese
Elemento di riscaldamento	Bobina di filo Cr2Al2Mo2
Velocità di riscaldamento	0-20°C/min
Coppia termica	Costruire in tipo K
Regolatore di temperatura	Controllore PID digitale/controllore PID touch screen
Precisione del controllo della temperatura	±1°C
Distanza di scorrimento	600 mm
Unità al plasma RF	
Potenza di uscita	5 -500W regolabile con una stabilità di ±1%
Frequenza RF	13,56 MHz ±0,005% di stabilità
Potenza di riflessione	350W max.
Corrispondenza	Automatico
Rumore	
Raffreddamento	Raffreddamento ad aria.
Unità di controllo precisa del gas	
Misuratore di portata	Misuratore di portata massica MFC
Canali del gas	4 canali
Portata	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2

Linearità	±0,5% F.S.
Ripetibilità	±0,2% F.S.
Linea di tubi e valvola	Acciaio inossidabile
Pressione massima di esercizio	0,45MPa
Controllore del flussometro	Controllore digitale a manopola/controller a schermo tattile
Unità di vuoto standard (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa per vuoto rotativa a palette
Portata della pompa	4L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro Pirani/Resistenza al silicone
Pressione nominale del vuoto	10Pa
Unità per alto vuoto (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa rotativa a palette+pompa molecolare
Portata della pompa	4L/S+110L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro composto
Pressione nominale del vuoto	6x10 ⁻⁵ Pa

Le specifiche e le configurazioni di cui sopra possono essere personalizzate

No.	Descrizione	Quantità
1	Forno	1
2	Tubo di quarzo	1
3	Flangia per il vuoto	2
4	Blocco termico del tubo	2
5	Gancio del blocco termico a tubo	1
6	Guanto resistente al calore	1
7	Sorgente di plasma RF	1
8	Controllo preciso del gas	1
9	Unità per il vuoto	1
10	Manuale operativo	1

Macchina Per Forno Tubolare Rotante Inclinato Per La Deposizione Chimica Potenziata Al Plasma (Pecvd)

Numero articolo: KT-PE16



introduzione

Vi presentiamo il nostro forno PECVD rotativo inclinato per la deposizione precisa di film sottili. La sorgente si abbina automaticamente, il controllo della temperatura programmabile PID e il controllo del flussimetro di massa MFC ad alta precisione. Funzioni di sicurezza integrate per la massima tranquillità.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di forno	PE-1600-60
Temperatura massima	1600°C
Temperatura di lavoro costante	1550°C
Materiale del tubo del forno	Tubo Al2O3 di elevata purezza
Diametro del tubo del forno	60 mm
Lunghezza della zona di riscaldamento	2x300mm
Materiale della camera	Fibra di allumina del Giappone
Elemento di riscaldamento	Disiliciuro di molibdeno
Velocità di riscaldamento	0-10°C/min
Coppia termica	Tipo B
Regolatore di temperatura	Controllore PID digitale/controllore PID touch screen
Precisione del controllo della temperatura	±1°C
Unità al plasma RF	
Potenza di uscita	5 -500W regolabile con una stabilità di ± 1%
Frequenza RF	13,56 MHz ±0,005% di stabilità
Potenza di riflessione	350W max.
Corrispondenza	Automatico
Rumore	
Raffreddamento	Raffreddamento ad aria.
Unità di controllo precisa del gas	
Misuratore di portata	Misuratore di portata massica MFC
Canali del gas	4 canali
Portata	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0-100 SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2

Linearità	±0,5% F.S.
Ripetibilità	±0,2% F.S.
Linea di tubi e valvola	Acciaio inossidabile
Pressione massima di esercizio	0,45MPa
Controllore del flussometro	Controllore digitale a manopola/controller a schermo tattile
Unità di vuoto standard (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa per vuoto rotativa a palette
Portata della pompa	4L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro Pirani/Resistenza al silicone
Pressione nominale del vuoto	10Pa
Unità per alto vuoto (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa rotativa a palette+pompa molecolare
Portata della pompa	4L/S+110L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro composto
Pressione nominale del vuoto	6x10 ⁻⁵ Pa
Le specifiche e le configurazioni di cui sopra possono essere personalizzate	

No.	Descrizione	Quantità
1	Forno	1
2	Tubo di quarzo	1
3	Flangia per il vuoto	2
4	Blocco termico del tubo	2
5	Gancio del blocco termico a tubo	1
6	Guanto resistente al calore	1
7	Sorgente di plasma RF	1
8	Controllo preciso del gas	1
9	Unità per il vuoto	1
10	Manuale operativo	1

Macchina Di Rivestimento Pecvd Con Evaporazione Potenziata Da Plasma

Numero articolo: KT-PED



introduzione

Potenziare il vostro processo di rivestimento con le apparecchiature di rivestimento PECVD. Ideale per LED, semiconduttori di potenza, MEMS e altro ancora. Deposita film solidi di alta qualità a basse temperature.

[Ulteriori informazioni](#)

Portacampione	Dimensioni	1-6 pollici
	Velocità di rotazione	0-20 giri/minuto regolabile
	Temperatura di riscaldamento	≤800°C
	Precisione di controllo	±0,5°C Regolatore PID SHIMADEN
Spurgo del gas	Misuratore di flusso	CONTROLLORE DEL FLUSSIMETRO DI MASSA (MFC)
	Canali	4 canali
	Metodo di raffreddamento	Raffreddamento ad acqua circolante
Camera a vuoto	Dimensione della camera	Φ500mm X 550mm
	Porta di osservazione	Porta di osservazione completa con deflettore
	Materiale della camera	Acciaio inox 316
	Tipo di porta	Porta ad apertura frontale
	Materiale del tappo	Acciaio inox 304
	Attacco pompa del vuoto	Flangia CF200
	Porta di ingresso del gas	Connettore φ6 VCR
Potenza del plasma	Alimentazione della sorgente	Alimentazione CC o RF
	Modalità di accoppiamento	Accoppiamento induttivo o capacitivo a piastra
	Potenza di uscita	500W-1000W
	Potenza di polarizzazione	500v
Pompa a vuoto	Pre-pompa	15L/S Pompa per vuoto a palette
	Porta della pompa turbo	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	Porta di scarico	KF25
	Velocità della pompa	Pompa a palette: 15L/s □ Pompa turbo: 1200l/s □ 1600l/s
	Grado di vuoto	≤5×10 ⁻⁵ Pa
	Sensore di vuoto	Vuoto a ionizzazione/resistenza/filmometro
Sistema	Alimentazione elettrica	AC 220V /380 50Hz

Potenza nominale	5kW
Dimensioni	900 mm X 820 mm X870 mm
Peso	200 kg



Kintek Solution

Sede centrale: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, Cina

